PASJ2020 WEPP04

AVF サイクロトロンの入射系の更新

UPDATE OF INJECTION SYSTEM OF THE AVF CYCLOTRON AT RCNP

中尾政夫^{#, A)},福田光宏^{B)},依田哲彦^{B)},神田浩樹^{B)},安田裕介^{B)},友野大^{B)},鎌倉恵太^{B)},森信俊平^{B)}, 齋藤高嶺^{B)},畑中吉治^{B)},田村仁志^{B)},永山啓一^{B)},Koay Hui Wen^{B)},森田泰之^{B)},武田佳次朗^{B)},大本恭平^{B)} Masao Nakao^{#, A)}, Mitsuhiro Fukuda^{B)}, Tetsuhiko Yorita^{B)}, Hiroki Kanda^{B)}, Yuusuke Yasuda^{B)}, Dai Tomono^{B)},

Keita Kamakura^{B)}, Shunpei Morinobu^{B)}, Takane Saito^{B)}, Kichiji Hatanaka^{B)}, Hitoshi Tamura^{B)}, Keiichi Nagayama^{B)},

Hui Wen Koay^{B)}, Yasuyuki Morita^{B)}, Keijiro Takeda^{B)}, Kyohei Omoto^{B)}

^{A)} Gunma University Heavy Ion Medical Center

^{B)} Research Center of Nuclear Physics, Osaka University

Abstract

The AVF cyclotron at the Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University is being upgraded in order to provide high quality and high intensity beams. One of the improvements is to increase the acceleration voltage of the injected ions from 15 kV to 50 kV at maximum to enable low emittance and high intensity beam injection. In this paper, we report on the injection system consisting of a baffle slit, inflector electrodes, Dee electrode tips and a phase slit, which are necessary for high quality beam injection of ions from the perpendicular injection line to the cyclotron. The injection system has been studied to minimize the eccentricity of the beam orbit, even when the injection voltage is high and the inflector is large, and to accelerate the beam with a small phase width using the phase slit and phase bunching technique. In addition, the design of the inflector is available. For the design, the electric and magnetic fields calculated by OPERA-3d TOSCA were used, and SNOP developed by Smirnov et al. in JINR, Russia, and OPAL developed in PSI, Switzerland, were used to calculate the beam trajectories to account for the space charge effects.

1. はじめに

大阪大学核物理研究センター(RCNP)では、原子核 物理の実験、ミューオン生成、医療用 RI 製造(α線核医 学治療)、ソフトエラー評価用中性子生成など多用途の ビーム需要を満たすために、AVF サイクロトロンの改良 工事を行っている[1-5]。本発表では、改良のうち AVF サ イクロトロンの入射系について述べる。

イオン源の取り出し電圧を向上[4,5]させることで、電流 を増加した場合でも空間電荷効果によるビーム広がりを 減少させ高効率でビーム入射することができる。また、加 速効率向上のため Dee 電極を 180°の 1 台から 90°の 2 台に変更するので Fig. 1 のように機器配置が変更になる。 それに対応するための入射系として、バッフルスリット、イ ンフレクター、Dee 電極先端部、位相スリット等の設計を 行った。サイクロトロンから取り出されるビームのエネル ギー広がりを低減するため、入射直後にビームを半径方 向にカットすることで位相の制限を行う位相プローブの 配置も重要になる。RCNP AVF は様々なイオン種・エネ ルギーに対応するため、ハーモニック1,2,3,6で加速する 必要があるが、インフレクターの交換によりいずれの条件 でも加速できるようにし、さらに交換の手間を省くために ハーモニック1.2.3の場合には共通インフレクターで入射 できるようにした。大電流ビームの検討には空間電荷効 果を考慮に入れる必要があるので、OPERA-3d [6]によっ て計算された電場と磁場を用いて、ロシア JINR の Smirnov 氏らが開発した SNOP [7,8]と、スイス PSI で開 発された OPAL [9]を併用して入射するビーム軌道の計

算を行った。



Figure 1: Schematic figure of the RCNP AVF cyclotron. Beamline and Yoke are now existing. Injection system, acceleration system (including Dees and cavity) and extraction system (including Deflector and Gradient Correctors) will be newly made.

2. 中心プラグの更新

同じ粒子を同じエネルギーまで加速する場合入射エ ネルギーを上げればスパイラルインフレクターを大型化 する必要があるが、このインフレクターを軸方向、下側か ら挿入するためには Fig. 2 のようにサイクロトロンのヨーク からポールの中央部にある中心プラグに空けられた穴を

[#] nakaom@gunma-u.ac.jp

PASJ2020 WEPP04

通過する必要があるが、穴は少なくとも直径 64 mm の大 きさが必要である。現状では中心プラグのインフレクター 下の隙間に電磁軟鉄を配置して磁場の低下を抑えてい るが、現在の駆動機構を使用し続けるため、駆動負荷は 増やせないので電磁軟鉄を増加することはできない。ま



Figure 2: Existing center plug and proposed new center plug.

た、対称性を保っために上下両方の中心プラグを対称 にする必要があり、これだけでは磁場の低下は避けられ ない。

単に中心プラグの穴の直径を拡大するだけでは、Fig. 3 のように TOSCA で計算した中心付近の磁場は 85 ガウス減少した。最も内側にあるトリムコイルは半径 161 mm





に存在するのでこの電流の増加で磁場を補正しようとす ると、磁場が減少した範囲より外の半径 100~200 mm 付 近の磁場が寧ろ増加してしまう。そこでトリムコイルを使 用しなくても元の磁場を再現できるように中心プラグ中央 部に突起をもうけることにした。突起の形状は円柱 (cylinder)と円錐(cone)の2タイプとし(Fig. 2)、これらを含 めて TOSCA で磁場計算を行うことで最適な値を計算し た。その結果、平均磁場は円柱の出っ張りで現在との差 を10ガウス以下に補正可能であることが示された(Fig. 3)。 このうち加工精度の高い円柱の出っ張りを採用した。

3. 中心領域の軌道とインフレクター電極

RCNP では多種のイオンを幅広いエネルギーで加速 する需要がある。ここで以下のようなことを考慮する必要 がある。

- 価数はイオン源で制限されるため重イオンでは質量電荷比が高くなってしまう。
- RF 周波数の調節可能領域は共振器の駆動範囲に よるため、16.5~37 MHz となる。
- また、ハーモニック2または6であればトップ加速が 可能で加速効率が高いため、できれば2または6 で加速したい。
- インフレクターの交換は可能にするが、交換は最低限にしたい。
- ハーモニック2加速のProton 65 MeV条件が最も 多く使用し、大電流が求められる条件であるから、 この場合にイオン源の最大電圧である 50 kV で入 射する。

最後の条件を満たすためには、Proton 65 MeV 条件よ りも中心磁場が高いものはより磁場半径の小さいインフレ クターが必要になる。このようなイオンは周回周波数が大 きいので主にハーモニック1で加速することになる。そこ で、ハーモニック1,2,3,6のために各々最適なインフレ クター製作して(ただし2と6の場合は同形状となった)、 インフレクター1,2,3の場合は2の場合に最適化された



Figure 4: Structure of central region and trajectories of accelerated ions in several different harmonics. Orbits of protons of 10, 65 and 80 MeV injected from Dee-S are shown in (a. Orbits of proton of 10 MeV and ⁴He²⁺ 30 MeV injected from Dee-N are shown in (b.

インフレクターを共用で使用できるものとした。また、インフレクターを抜けて Dee に入射する部分は、ハーモニック2 で位相バンチング[10]を行うために Dee を 20°幅広くしているが、これはハーモニック3 では 60°で効率の大幅な低下、ハーモニック6 では 120°となり加速不可能にな

Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

PASJ2020 WEPP04

るため、Dee-Sからの入射はハーモニック1,2,3 用、Dee-Nからの入射はハーモニック3,6 用として使い分けることとした。

Figure 4 に、Dee-N, Dee-Sの夫々の方向から入射したいくつかの粒子の場合の軌道を書き入れた。北の方角にあるDeeがDee-N,南の方角にあるDeeがDee-Sと名付けられた。Dee-Sから、ハーモニック1~3の夫々の場合に共通インフレクターで入射が可能であることが明らかになった。図には書き入れていないが、Dee-Nからハーモニック6で入射される⁴He²⁺30 MeV条件は、Dee-Sからの共通インフレクターによる入射によりハーモニック3で加速することも可能であり、実験スケジュールにより選択可能である。

4. 重イオンの加速

質量電荷比が大きく、到達エネルギーも高い重イオン では1ターン当たりの軌道半径の増加が小さい。同じ ハーモニック3 での加速であっても、Proton 10 MeV条 件のように軽く磁場が低い粒子よりも40Ar12+486 MeV 条 件のような重イオンの軌道の方が、入射位置が同じで あっても相対的な偏心が大きいまま数ターン周回するこ とになる。この原因により、⁴⁰Ar¹²⁺はシミュレーション上で ハーモニック3 ではうまく位相に乗った加速が困難で あった。そこでハーモニック2で加速することにしたが、 周回周波数が 7.632 MHz なので RF 周波数が 22.896 MHz から 15.264 MHz となり、共振器の最低周波数より 低くなってしまった。そこで取り出しエネルギーを 570 MeV まで上げると16.503 MHz となり加速できるが、今度 は中心付近の磁場が 1.791 T となり磁場の最大値~1.65 T を超えてしまう。そこでイオン源で生成する⁴⁰Ar イオン の価数を 12 から 13 に上げ、取り出しエネルギーを 570 MeV のままとすることで、磁場は 1.653 T となり、これは 可能な磁場の値である。この条件で外周まで安定して加 速できることを SNOP で確認した。

5. 位相スリット位置でのビーム分布

Figure 5 に中心領域の概略図と位相スリットの挿入方向(赤線)を示した。Proton 65 MeV 条件の場合は Dee-S 方向から入射するので、まず加速されるギャップを 1st ギャップ、ビームが回転する方向に順に、2nd, 3rd, 4th ギャップと呼ぶ。1 周して再び 1st ギャップと同じギャップ を通るときを便宜上 5th ギャップと呼ぶ。粒子のギャップでの RF 位相とは、ある 1 個の粒子がそのギャップを通過 するときの Dee 電極の RF 位相を表すものとする。

Figure 6 (a に、1st ギャップでの位相と位相スリットでの 半径の関係を示した。ここで濃い線はエミッタンスを 0 と してサイクロトロンの軸上から入射した粒子の取る値を、 薄い*印はインフレクター上、Z=70 mm の位置で位相空 間内で正立する 3 mm × 10 mrad のビームの値を示す。 エミッタンスが 0 の場合は位相と半径の関係がある曲線 の上に乗っているので位相スリットでビーム半径を制限 すれば位相が制限することが出来る。一方でビームが有 限のエミッタンスを持っている場合には位相スリットで半 径を制限しても、ある範囲以下に位相幅を制限すること



Figure 5: Definition of the gaps and the azimuth of the phase slit (red line). 5th gap means 1st gap of second turn.



Figure 6: PF phase of the Dee electrodes and radius at the phase slit. (a Relation at RF phase at the 1st gap. Orange line is central orbit. (b Relation at RF phase at the 1st to 5th gaps. These results are calculated for 65 MeV Proton. The injected beam is 3 mm \times 10 mrad above inlet of the inflector electrode (70 mm from the median plane).

PASJ2020 WEPP04

が困難である。

一方で、ビームの RF 位相は通過するギャップによっ て異なり(Fig. 6(b)、これは加速ギャップが4つある一方で 磁場の三回対称性により軌道が膨らんだ三角形を取るこ とによる。従って、一カ所の位相と半径の関係のみでは、 取り出し時の粒子のエネルギーは決定せず、複数ターン の複数のギャップにおける位相を比較して判断する必要 がある。

6. 結論

サイクロトロンへの入射エネルギーの向上、Dee 電極の更新に伴い、サイクロトロンの入射部の軌道計算を行った。軌道計算に基づき、入射系として、バッフルスリット、インフレクター、Dee 電極先端部、位相スリット等の設計を行っている。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP20H04454 および国立研究 開発法人科学技術振興機構 産学共創プラットフォーム 共同研究推進プログラム(JST、OPERA、JPMJOP1721) の支援を受けて実施しました。また、ビーム計算コードを 使用させていただいた SNOP および OPAL の開発者に 感謝いたします。

参考文献

- [1] H. Kanda et al., PASJ2020, In these Proceedings, THSP09.
- [2] M. Fukuda et al., PASJ2020, In these proceedings, WEOO06.
- [3] T. H. Chong et al., PASJ2020, In these proceedings, THPP06.
- [4] T. Yorita et al., PASJ2020, In these proceedings, FRPP23.
- [5] K. Omoto et al., PASJ2020, In these proceedings, FRPP50.
- [6] OPERA-3D, Cobham plc; http://www.cobham.com/
- [7] V. L. Smirnov and S. B. Vorozhtsov, SNOP Beam Dynamics Analysis Code for Compact Cyclotrons Proc. RuPAC 2012 (St. Petersburg, Russia, 2012).
- [8] V. L. Smirnov, Computer Modeling of a Compact Isochronous Cyclotron Physics of Particles and Nuclei 46 pp. 940-955 (2015).
- [9] A. Adelmann *et al.*, "The OPAL (Object Oriented Parallel Accelerator Library) Framework", Paul Scherrer Institut, PSI-PR-08-02, (2008 - 2018).
- [10] N. Miyawaki *et al.*, "Geometric analysis of phase bunching in the central region of cyclotron" Nucl. Instr. and Meth. A715 (2013) 126.